① 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-237721

⑤Int Cl.⁴ H 01 L

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)10月17日

21/203

7739-5F

審查請求 有 発明の数 1 (全3頁)

⑤発明の名称 MBE成長装置

> 21)特 願 昭61-79144

⑫出 願 昭61(1986) 4月8日

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ⑫発 明 斉 藤

工業技術院長 70出 顛 人

> 明 細

1. 発明の名称

MBE成長装置

2. 特許請求の範囲

所定の真空状態にされるチャンバー内に、成 長されるソースを入れた分子線源セルを有してな るMBE成長装置において、

該チャンバーの外に設けられ前記分子線源セル と開閉バルブを有するパイプを介して結合されさ 。らに該ソースが溜められた外部ソース液溜と、

一方の電極は前記分子線源セル内に配置され、 他方の電極は該外部ソース液溜内のソースに接触 され、両電極間の導通状態をモニタすることで該 分子線源セル内のソースの液面高さをモニタする 液面モニタ手段とを有し、

該液面モニタ手段が該分子線源セル内のソース の液面の高さが所定位置以下になったことを検出 した時に前記開閉バルブを介して外部ソース液溜 より該分子線源セルへソースを供給するようにし たことを特徴とするMBE成長装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

(概要)

本発明はMBE成長装置において、分子線源 セル内のソースの補給をチャンバーの真空を破る ことなく自動的に行うことができるようにするた め、分子線源セルに連結された外部ソース液溜と、 分子線源セル内のソースの液面をモニタする手段 とを設け、所定の液面の高さ以下になったとき連 結部の開閉バルブを介してソースを自動的に補給 するようにしたものである。

## (産業上の利用分野)

本発明は化合物半導体において使用されるM BE成長装置の分子線源セルに係り、特に、溶融 するソースを入れる分子線源セルのソースの液面 の位置を自動的に調整することができる分子線源 セルの改良に関する。

(従来の技術とその問題点)

従来の分子線源セルとしては、一定の量のソ

一スをチャージした後、真空チャンバの中に入れいない。 超高真空中で分子線としてソースを取り出に従っていり出に従ってが消費されるに用されては、ソースが消費される使用で分子線としての機に使用面積にでしたが低下し、例えば一般で面面の温度があるいはセルの場合ソースの腹があるがあるというというというというでは、真空を破びいるというには、真空をはよるというでは、再チャージおよというでは、再チャージおよというではがあった。 要が間と労力を必要とするという欠点があった。

そこで本発明の目的は、分子線源セル内のソースの液面の位置を検出し、真空を破ることなくソースを追加チャージすることによって安定な分子線強度を得る分子線源セルを有するMBE成長装置を提供することにある。

## (問題点を解決するための手段)

本発明は、溶融しているGa等のソースが導

る。

第1図は本発明の実施例のMBE成長装置であ **る。分子線源ソースとしてはGaソースを用いた。** の装置はチャンバ10内に設けられた分子線源 世ル12内にGaのソース13が溜められていて、 ヒータ14により加熱され溶融したGaソース13 の液面からの蒸発による分子線をヒータ18で加 熱された基板 1 6 に照射することで成長を行なっ ている。そして分子線源セル12には外部のソー ス液面20とパイプ28で連結され、ソース液溜 20内にはGaのソース21が溜められている。 また図のようにセル12の開口部近傍には液面モ ニター32の一方の電極34を設置し、もう一方 の電極36は外部ソース液溜20の部分に設置し た。パイプ28の途中に開閉用のスロットバルブ 30を設けた。外部ソース液溜めは20には排気 用の管とGaソース供給用の管とが設けられ、そ れぞれバルブ24、22によって止められるよう になっている。排気用の管は、外部ソース液溜内 の真空度をチャンバ10内の真空度と同等に保つ

電性であることを利用し、導通検知により液面の 位置をモニターするようにした液面モニタ手段を 設けたものであり、また、分子線源セル内から 真 空チャンバ外に真空排気が可能な外部ソース液溜 めを設け、分子線源セルと外部ソース液溜めの間 には開閉用のスロットバルブを設け、このバルブ の開閉を前述の液面検出信号で行なうようにした ものである。

### (作用)

上記の様な構成をとることによって、ソース 液面が下がった時、液面モニタ手段がそれを検知 し、開閉バルブを開くことで外部ソース液溜から 分子線源セル内にソースを自動的に補給するよう にすることで、セル内のソースの液面の高さを一 定にし、分子線強度を一定に保つようにする。

#### 〔実施例〕

以下、本発明の実施例に従って詳細に説明す

ためであり、一般的には10-8~\*Torr程度である。

### (発明の効果)

一般に分子線源セル12はより多くの分子線の放射が得られるようにラッパ形状をしているため、本発明の様にソース13の液面の高さが一定に保たれるとその液面の面積も一定に保たれる故分子線の強度は一定に保たれる効果が得られる。

また分子線源セル12に設けられたヒータ14 の加熱により、一般にはセル12の開口部は高く、 底部は低くなるよう温度分布が設けられるが、本発明の様にソース13の液面の高さが一定に保たれるとその液面の温度も一定に保たれるため、同様に分子線強度は一定に保たれるのである。

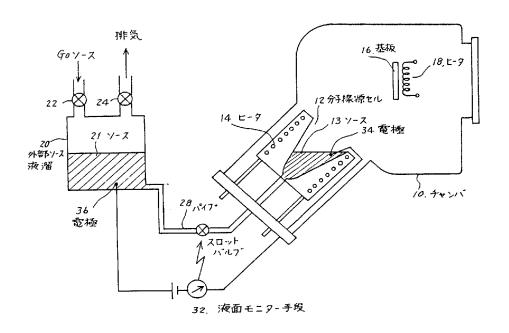
さらに本発明によれば、チャンバの真空を破る ことなくソースを追加することができ作業効率が 向上する。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本願の実施例のMBE成長装置の構 ・造図である。

10 はチャンバ、12 は分子線源セル、20 は外部ソース液溜、28 はパイプ、30 は開閉用バルブ、32 は液面モニタ手段、34、36 は電極である。

特許出願人工業技術院及等々力 達



本発明の実施例

第 1 図

**PAT-NO:** JP362237721A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 62237721 A

**TITLE:** MBE GROWTH APPARATUS

PUBN-DATE: October 17, 1987

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME COUNTRY

SAITO, JUNJI

# **ASSIGNEE-INFORMATION:**

NAME COUNTRY

AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL N/A

**APPL-NO:** JP61079144

APPL-DATE: April 8, 1986

INT-CL (IPC): H01L021/203, H01L021/26

US-CL-CURRENT: 118/726

## **ABSTRACT:**

PURPOSE: To maintain molecular beam intensity constant by supplying a source to a molecular beam source cell from an external source liquid reservoir through a switching valve when liquid level monitoring means

detects that the height of source liquid level in the cell becomes a predetermined position or lower to maintain the height of the source liquid level in the cell constant.

CONSTITUTION: A liquid level monitor 32 utilizes the fact that Ga of sources 13, 21 has conductivity. When the fact that the liquid level of the source 13 reduces is detected, a throttle valve 30 is opened by a detection signal, and Ga source 21 is supplied from a source liquid reservoir 20 into a molecular beam source cell 12. When the fact that the liquid level rises is detected by the monitor 32, the valve 30 is closed by its detection signal. Thus, the liquid level of the Ga source 13 in the cell 12 is always maintained constant.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio